表面化学 UG

吸着 CO が引き起こす Fe/Cu(001) 薄膜の磁気状態の変化

阿部 仁^{A,B,*}、雨宮健太^C、松村大樹^D、宮脇 淳^A、 佐古恵理香^C、大槻 匠^A、坂井延寿^A、太田俊明^E

^A東大院理、^B学振DC、^C高エネ機構 物構研、^D原研、^E立命館大学 *:hitoshi@chem.s.u-tokyo.ac.jp

Fe/Cu(001) 等の磁性薄膜の磁気異方性は、分子吸着等に よって影響を受ける [1,2]。しかし、この効果は完全には理 解されていない。Fe/Cu(001) 薄膜で、吸着 CO が引き起こ す新たな磁気状態が見られたので報告する。

実験は KEK-PF BL-11A、東大 RCS BL-7A にて行った。 蒸着作製した Fe/Cu(001) を試料とし、CO を 5 L を曝露し吸 着させた。700 Oe で磁化し、CO 吸着前後で測定を行った。 直入射 (NI) 及び斜入射 (GI) の XMCD から磁化方向を決定 した。深さ分解 XMCD[3,4] は、MCP 検出器を用い、そこ に入る電子の出射角の違いから検出深度を制御して行った。 図 1、図 2 に、Fe 2, 4 ML の CO 吸着前後の Fe L 端 XMCD

スペクトルを示す。CO 吸着前は、Fe 2 ML, 4 ML ともほ ぼ同じ XMCD スペクトルで、面直磁化である。スピン磁気 モーメント (m_s) を求めると 2 ML では 2.3 μ_B 、4 ML では 2.5 μ_B であった。

CO/Fe(2 ML)/Cu(001) の XMCD スペクトルは CO 吸着 前のものとほぼ同様であり、 $m_s = 2.3 \mu_B$ と求められた。一 方、CO/Fe(4 ML)/Cu(001) は、NI 測定では XMCD シグナ ルが観られず、GI 測定にのみ現れた。すなわち面内磁化で あり、吸着 CO によって面直磁化から面内磁化へのスピン 再配列転移が起こったことがわかる。 m_s を求めると 1.1 μ_B であった。この 1.1 μ_B という値は、元の 2.4 μ_B の約半分で あり、4 ML のうちの 2 ML 分の磁化が消失したと推定され る。そこで Fe の m_s について、深さ分解 XMCD 測定を行っ た。検出深度が浅いと、観測される m_s が小さくなることが わかり、表面の m_s が消失したと考えられる。簡単なモデル で考察した結果、4 ML のうち上(表面)側 2 ML の磁化が ほぼ消失し、下側 2 ML の磁化が残っているという描像が得 られた。

以上のように、吸着 CO によって、4 ML の Fe 薄膜では 上側 2 ML の磁化が消失するとともに面内磁化が発現した。 2 ML では特に変化は見られなかった。薄膜の構造等につい ても、LEED 像等を示して議論したい。

参考文献

- [1] W. L. O'Brien *et al.*, Phys. Rev. B **54**, 9297 (1996)
- [2] D. Matsumura *et al.*, Phys. Rev. B **66**, 024402 (2002)
- [3] K. Amemiya et al., J. Phys. Condens. Matt. 15, S561 (2003)
- [4] K. Amemiya et al., Appl. Phys. Lett. 84, 936 (2004)



図 1: (a) Fe(2 ML)/Cu(001)、(b) CO/Fe(2 ML)/Cu(001) の Fe L 端 XMCD スペクトル。実線が NI、破 線が GI のもの。



図 2: (a) Fe(4 ML)/Cu(001)、(b) CO/Fe(4 ML)/Cu(001) の Fe L 端 XMCD スペクトル。実線が NI、破 線が GI のもの。磁化方向が CO 吸着 後では、面内方向に変わっている。